

Daten & Fakten

Sitz der Gesellschaft Nöthnitzer Str. 64
01187 Dresden
(Campus der TU Dresden)

Geschäftsführer Dr. Johann Harter

Historie u. Unternehmensziele

Im **Juni 2006** unterzeichneten der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Prof. Dr. Georg Milbradt, der Rektor der TU Dresden, Prof. Hermann Kokege, und der Vorstandsvorsitzende der Qimonda AG, Kin Wah Loh eine Absichtserklärung (MoU) zur Gründung einer gemeinnützigen Forschungsgesellschaft, mit dem Ziel, die Aktivitäten in der anwendungsorientierten Grundlagenforschung weiter auszubauen.

Mit der TU Dresden wurde eine auf Spitzenniveau forschende und international ausgerichtete Universität als Partner gewonnen. Die Partnerschaft verfolgt das Ziel, neben einem beschleunigten Wissenstransfer von der Hochschule zur Industrie auch die universitäre Ausrichtung und Ausbildung anwendungs- und praxisorientierter zu gestalten. In diesem Kontext wird sich die NaMLab verstärkt in die regionalen, nationalen und internationalen Wissenschaftsnetze einbringen und die Attraktivität des Standortes Dresden sowie die Bedeutung der deutschen und europäischen Halbleiterforschung stärken.

Das Unternehmen wurde am **21. Juli 2006** von der Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG und der TU Dresden als paritätisches Beteiligungsunternehmen gegründet. Die NaMLab gGmbH ist deutschlandweit das erste Joint Venture in der Form einer „Private Public Partnership“, die aus der direkten Beteiligung einer Technischen Universität mit einem führenden Industrieunternehmen aus der Halbleiterindustrie hervorgegangen ist.

Meilensteine

06/2006	Unterzeichnung Memorandum-of-Understanding (MoU) Absichtserklärung zur Gründung der NaMLab gGmbH
11/2006	1. Spatenstich
12/2006	Baubeginn (Herstellen des Gebädefundaments)
03/2007	Richtfest
05/2007	Fertigstellung des Rohbaus
15.10.2007	Einweihungsfeier / Gebäudebezug
16.10.2007	Konstituierende Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats
25.10.2007	Transfer der Laborgeräte von Qimonda, Aufbau und Inbetriebnahme
25.11.2007	Transfer der Reinraumgeräte von Qimonda, Aufbau und Inbetriebnahme
02.01.2008	Aufnahme des wissenschaftlichen Geschäftsbetriebes

Fokus

Künftige Speichergenerationen benötigen neue Materialien in Schichtdicken von einigen Atomlagen. Deren strukturelle, physikalische und elektrische Eigenschaften, bestimmen Leistungsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit der Speicherchips.

NaMLab konzentriert sich auf eine anwendungsorientierte und industrienahe Materialforschung, die der produktionstechnischen Umsetzung mit einem Zeitfenster ca. 7 - 10 Jahre voraus läuft. Schwerpunktmäßig wird sich die NaMLab auf die Identifizierung, Herstellung und Charakterisierung von neuen Halbleitermaterialien sowie auf die Integration dieser Materialien in (neue) Halbleiterprodukte mit Strukturgrößen unterhalb von 30 nm fokussieren.

Entscheidungsgremien

Die Geschäftsführung berichtet an die Gesellschafterdelegation.

Gesellschafterdelegation

TU Dresden

Dr. Undine Krätzig
Prof. Dr.-Ing. Peter Schegner

Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG

Dr. Jürgen Rüstig
Wolfgang Schmid

Über die wissenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens entscheidet der Wissenschaftliche Beirat auf Vorschlag des Wissenschaftlichen Leiters.

Wissenschaftlicher Beirat

MPI f. komplexe Systeme

Prof. Dr. Peter Fulde

Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG

Dr. Wolfgang Müller

TU Dresden

Prof. Dr. Johann W. Bartha

University of Albany (USA)

Prof. Dr. James G. Ryan

Finanzierung

Als gemeinnützige Körperschaft (gGmbH) finanziert sich die NaMLab zu überwiegenden Teilen aus öffentlichen Fördermitteln des Freistaates Sachsen, der Bundesrepublik Deutschland (BMBF) und der Europäischen Union.

Eine weitere Einnahmequelle sind die industrielle Auftragsforschung sowie durch Einnahmen aus der Verwertung von gewerblichen Schutzrechten.

Das am 15. Oktober 2007 fertig gestellte (neue) Labor- und Bürogebäude wurde mit Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) und des Freistaates Sachsen (SMWK) finanziert.

Gebäude

Investition

5 Mio. EUR

Daten

3-geschossiges, schwingungsgedämpftes Labor- und Bürogebäude,

1. Etage

Laborbereich, 4 Laborräume mit einer Raumgröße von je 25 m², Lager- und Technikflächen

2. Etage

Reinraum mit einer Nutzfläche von ca. 300 m², Reinraumklasse 1000 (U.S. Norm)

3. Büro- und Verwaltungsetage

Einzel- und Gruppenbüros auf einer Gesamtfläche von 250 m²

Personalstruktur

Technologie- und Wissensvorsprung ist für die Halbleiterindustrie mit ihren schnellen Innovations- und Vermarktungszyklen von herausragender Bedeutung. Nur mit einer an der Zeitskala der Industrie ausgerichteten Forschung können wettbewerbsentscheidende Ergebnisse erarbeitet werden. Hierfür ist geeignetes wissenschaftliches Personal erforderlich, das am besten im Umfeld der Technischen Universität gefunden werden kann.

Wissenschaftliche Leitung & Betreuung

Die Betreuung erfolgt durch erfahrene und festangestellte Wissenschaftler und den wissenschaftlichen Leiter, der als Honorarprofessor in den akademischen Lehrbetrieb der TU Dresden eingebunden sein wird.

Diplomanden, Doktoranden, Gastwissenschaftler

Für die einzelnen Forschungsprojekte wird das Unternehmen zeitlich befristete junge Nachwuchswissenschaftler (Diplomanden, Doktoranden, Gast- und Austauschwissenschaftler) einstellen.

Personalbestand

(per Oktober 2007)

Geschäftsführung: **1**

Verwaltung (inkl. Gebäudetechnik): **3**

Forschung & Lehre (inkl. Wiss.-Leiter): **3**

Mitarbeiter bis Ende 2008: ca. **20**

bis Ende 2009: ca. **27**

**Maschinen- u.
Anlagenausstattung**
(Forschungsbetrieb)

Materialabscheidesysteme für Dielektrika und leitende Materialien
(MBE, PVD, CVD)

Anlagen zur Probenpräparation sowie

Analysemethoden für die strukturelle, physikalische und elektrische
Charakterisierung

**Aktuelle
Forschungsprojekte**

Herstellung und Analyse von high-K-Materialien für zukünftige
Speichercondensatoren (MEGA EPOS); gefördert durch das BMBF
Projektstart: 1. Juni 2007
FKZ: 13N9264

PVD/MBD Deposition und Metallisierung (KONDOR); gefördert durch das
BMBF
Projektstart: 1. August 2007
FKZ: 13N9449.

Umweltschutz

Das Gebäude wurde nach den geltenden und strengen Anforderungen der
Halbleiterindustrie sowie den Umweltschutzbedingungen der Bundesrepublik
Deutschland errichtet.